PAT-NO:

JP404100533A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 04100533 A

TITLE:

VACUUM CONTAINER

PUBN-DATE:

April 2, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MARUYAMA, TAKAHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP02217609

APPL-DATE:

August 18, 1990

INT-CL (IPC): B01J003/03, C09K003/10 , C22C019/03

US-CL-CURRENT: 118/733

ABSTRACT:

PURPOSE: To repeatedly use one seal material by forming the seal material interposed between a lid body and a vacuum container main body from a shape memory alloy and providing a heater heating the seal material to the transition temp. thereof or higher to restore the same to its original shape.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer is inserted in a treatment chamber la from a taking in and out port 2 in such a state that a door 3 is opened and, thereafter, the door 3 is closed. A seal material 11 composed of a shape

memory alloy is preheated before the door 3 is closed to be set to an initial state. when the door 3 is closed to clamp the seal material to a main body 1 by a clamping member, the seal material 3 is deformed so as to collapse between the door 3 and the main body 1. By this method, high airtightness like a usual metal seal can be obtained. After the completion of etching treatment, the door 3 is opened and the semiconductor wafer is taken out. When the door 3 is opened, the seal material 11 is in a deformed state at about room temp. but, by heating the door 3 to 70° C or higher by the heater 13 built in the door 3, the seal material 11 is restored to its original shape before deformation.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

9日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-100533

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)4月2日

B 01 J 3/03 C 09 K 3/10 // C 22 C 19/03 J 2102-4G Q 9159-4H A 8928-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

9発明の名称 真空容器

②特 顧 平2-217609

匈出 顧 平2(1990)8月18日

@発明者 丸山

降 引.

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

图代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明細書

1. 発明の名称

真空容器

2. 特許請求の範囲

被処理物の出し入れ口を開閉する蓋体を備えた 真空容器において、前記蓋体と真空容器本体との 間に介装されるシール材を形状記憶合金によって 形成すると共に、このシール材を転移温度以上に 加熱して復元させるヒータを設けたことを特徴と する真空容器。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は被処理物の出し入れ口を開閉する董体 を備えた真空容器に関し、特に董体用シール材の 構造に関するものである。

〔従来の技術〕

世来のこの種の真空容器としては、例えば半導体記憶装置を製造する際に使用するエッチングチャンパーを第3図によって説明する。

第3図は従来のエッチングチャンバーの概略構成を示す断面図である。同図において、1はエッチングチャンバーの本体で、この本体1は内部に処理室1 a が設けられ、一側部にはこの処理室1 a に対して半導体ウェハ(図示せず)を出し入れするための出し入れ口2が閉口されている。

3 は前記出し入れ口 2 を開閉するための蓋体としての録で、この録 3 は本体 1 に接離自在に接時されている。 4 は前記録 3 と本体 1 との間の際間から気体が漏洩するのを防ぐためのシール材で、このシール材 4 としては、ふっ素系ゴムによって、形成された 0 リングが使用されている。そして、野3をボルト(図示せず)等の締結部材によって本体 1 に固定して出し入れ口 2 を塞いだ時に、本体 1 の側面に圧接されるように構成されている。

5 は本体 1 内の気体を排出するための排気装置で、排気管 6 を介して本体 1 の処理室 1 a に連通されている。なお、 7 は排気管 6 を開閉するためのバルプである。

このように構成された従来のエッチングチャンバーでは、扉3を開いて半導体ウェハを本体1の処理室1 a 内に挿入し、扉3を閉じて排気装置5によって処理室1 a 内を減圧させる。この状態でエッチングガスが供給される。エッチング終了後は、排気装置5によってエッチングガスを排出させてから扉3を開き、エッチング処理の終了した半導体ウェハを本体1外へ取り出す。

(発明が解決しようとする課題)

おいて前記第3図で説明したものと同一もしくは 同等部材については、同一符号を付し詳細な説明 は省略する。これらの図において、11は本体1 と扉3との間の気密を保持するためのシール材で、 このシール材ししは形状記憶合金からなり、断面 略円形の円環状に形成されている。そして、この シール材11は、扉3における本体1と対向する 部分に形成された環状の凹海12内に装着されて 保持されており、扉3を本体1に固定して出し入 れ口 2 を閉塞した時に、本体 1 の側面に圧接され るように構成されている。このシール材11を形 成する形状記憶合金としては、例えばチタンとニ ッケルの合金が採用されており、ある転移温度以 下で変形させても転移温度以上に加熱すれば元の 形状に戻すことができる。この転移温度は、チタ ンーニッケル合金の場合、その混合比を変えるこ とによって、-180℃~100℃程度まで調整 することができる。本実施例では転移温度が10 てになるように合金の混合比を調整したものを使 用した。

(課題を解決するための手段)

本発明に係る真空容器は、董体と真空容器本体 との間に介装されるシール材を形状記憶合金によ って形成すると共に、このシール材を転移温度以 上に加熱して復元させるヒータを設けたものであ る。

〔作 用〕

董体を真空容器本体に締め付けることにより形 状記憶合金製シール材が変形して気密が保持され、 董体を開いた時にヒータで前記シール材を加熱す ることによって、シール材は変形前の形状に復元 する。

(実施例)

以下、本発明の一実施例を第1図(a) ~(d) によって詳細に説明する。

第1図(a) ~(d) は本発明に係る真空容器の機略構成を示す断面図で、同図(a) は蘇を閉める前の初期状態、同図(b) は蘇を閉めた状態、同図(c) は処理後に蘇を開けた状態、同図(d) はヒーターにより加熱を行なった状態を示す。これらの図に

13は前記シール材11を転移温度以上に加熱するためのヒーターで、このヒーター13は輝3に内蔵されている。

次に、このように構成された真空容器の動作に ついて説明する。先ず、扉3を開けた状態で出し 入れ口2から半導体ウエハを処理室1a内に挿入 し、扉3を閉じる。シール材11は、扉3を閉じ る前に予め加熱して第1図(a) に示すように初期 状態にしておく。扉3を閉じて締結部材によって 本体』に締付けると、シール材11は第1図(b) に示すように、屁3と本体1との間で潰れるよう に変形する。これによって、通常のメタルシール のように高い気密性を得ることができる。半導体 ウエハのエッチング処理終了後、躁るを開いて半 導体ウェハを本体1外へ取り出す。扉3を開ける と、室温程度ではシール材11は第1図(c) に示 すように変形したままであるが、扉3に内蔵され たヒーター13により銅3の温度を10で以上に 上げることによって、シール材11は第1図(d) に示すように元の変形前の形状に復元する。

特開平4-100533(3)

したがって、本発明に係る真空容器では、エッチングガスの悪影響を受けることの少ないシール 材11を繰り返し使用することができ、しかも課 3を反復して開閉しても、その都度高い気密性が 得られる。

なお、本実施例ではシール対 I 1 を断面円形を 呈する円環状に形成した例を示したが、シール材 としては、断面 C 字状を呈する円環状に形成した り、管体を円環状に丸めて形成したりすることも できる。断面 C 字状に形成した例を第 2 図に示す。

第2図は断面C字状を呈する円環状に形成されたシール材の他の実施例を示す斜視図である。同図において前配第1図(a)~(d)で説明したものと同一もしくは同等部材については、同一符号を付し詳細な説明は省略する。第2図に示すシール材11は、断面C字状を呈する円環状に一体成形されており、円環の内周部分が開放されている。このような構造とすると、歸3を本体1に持結させる力を小さく済ますことができ、シールの信頼性を高めることができる。

チング装置に応用した場合、従来のゴム製のシール材を用いた時のようなエッチングガスによる影 酒や腐食がなくなる関係から、耐久性に優れかつ 発慮の少ないエッチング装置を得ることができる。 4. 図面の簡単な説明

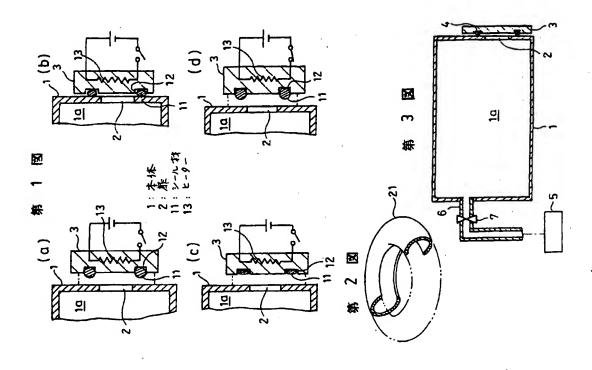
第1図(a) ~(d) は本発明に係る真空容器の概略構成を示す断面図で、同図(a) は扉を閉める前の初期状態、同図(b) は扉を閉めた状態、同図(c) は処理後に扉を開けた状態、同図(d) はヒーターにより加熱を行なった状態を示す。第2図は断面C字状を呈する円環状に形成されたシール材の他の実施例を示す斜視図、第3図は従来のエッチングチャンバーの概略構成を示す断面図である。

1····本体、2···・扉、1·1···・シール材、1 3···・ヒーター。

代理人 大岩塘雄

また、本実施例では真空容器としてエッチング チャンパーを例示したが、本発明はこのような限 定にとらわれることなく、開閉する録を有する真 空容器であれば、どのような容器であっても適用 することができる。

(発明の効果)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.